BEAM COMISSIONING OF KEK DIGITAL ACCELERATOR

T. Iwashita^{#1}, T. Adachi^{1,2}, T. Arai¹, Y. Arakida^{1,2}, K. Okazaki³, K. Okamura^{1,2}, E. Kadokura¹, M. Kawai¹, T.

Kawakubo¹, T. Kubo¹, T. Kubo¹, K. Koyama¹, W. Jian⁴, H. Someya¹, A. Takagi^{1,2}, K. Takayama^{1,2,5}, A. Tokuchi⁶, H.

Nakanishi¹, M. Hashimoto¹, S. Harada⁷, L. K. Wah², and M. Wake^{1,2}

¹KEK, Tsukuba, Ibaraki, Japan

²Graduate University of Advanced Studies (KEK), Tsukuba, Ibaraki, Japan

³Nippon Advanced Technology Co. Ltd. (NAT), Tokaimura, Ibaraki, Japan

⁴Nagaoka University of Technology, Nagaoka, Niigata, Japan

⁵Tokyo Institute of Technology, Nagatsuda, Kanagawa, Japan

⁶Pulse Power Laboratory, Kusatsu, Shiga 520-0806, Japan

⁷Tokyo City University, Setagaya, Tokyo, Japan

Abstract

KEK Digital Accelerator (KEK-DA) is a renovation of old 500 MeV Booster Synchrotron. The DA is expected to open up new areas of research because it can provide any ion beam from hydrogen to Uranium without an injector. The construction of the accelerator and the low energy beam transport line are finished in the last fiscal year, we have started the beam commissioning of KEK-DA. The first plan of us is to accelerate helium ion produced in ECR ion source. We have developed new type of chopper: Einzel lens chopper which utilize solid state Marx generator. Beam injection, circulation, and confinement experiment with barrier voltage are reported.

KEK デジタル加速器の運転開始

1. イントロダクション

デジタル加速器¹¹は大型の入射器を使用しない誘 導加速シンクロトロンである。誘導加速シンクトロ ンは 2000 年に KEK の高山・木代により提案^[2]され 2006 年に KEK 12 GeV-PS において原理実証実験が 行われた^[3]。図 1 にデジタル加速器の概念図を示す。



図1:デジタル加速器の概念図

ハイパワー半導体をスイッチング素子として用い たスイッチング電源による高電圧パルスで誘導加速 セル(1:1のトランス)を駆動する。誘導加速セル に発生する誘導電圧で二次側を周回する荷電粒子を 加速する。従来の高周波シンクロトロンと異なり、 空洞の共振周波数や高周波アンプのバンド幅制限か

iwashita@www-accps.kek.jp

ら完全に自由なシンクロトロンである。結果として、 非常に速度の遅い粒子から光速の粒子までを1台で 加速でき⁽⁴⁾、新しいタイプのイオン加速器として ビーム応用が期待されている。

2. KEK デジタル加速器

KEK デジタル加速器(KEK-DA)では 2006年に 運転を停止した KEK 12 GeV-PS の 500MeV ブース ターの RF 加速装置や入射システムを除く部分を再 利用している^[5]。建設は終了し、ビームコミッショ ニングを開始した。図 2 に KEK デジタル加速器の 概略図を示す。上流に ECR イオン源(後述)を搭 載する 200 kV 高圧ターミナルを新たに建設、ビー ム輸送ラインは旧 40MeV ビームラインの電磁石お よびビームダクトの一部を再利用している。表1に KEK-DA のパラメータを示す。



図 2: KEK-DA 概略図

周長	37.71 m
曲率半径	3.3 m
磁束密度 (Max/Min)	0.03 / 0.84 T
最大加速電圧/周	3.2 kV
繰り返し	10 Hz
Betatron Tune v_x/v_y	2.1/2.3

表1: KEK デジタル加速器パラメータ

3. ECR イオン源

イオン源として、永久磁石方式のパルスモードで 動作する引き出し電圧 14 kV、9.4 GHz ECR イオン 源を新たに開発した。ECR イオン源は 186 kV に昇 圧された高圧ターミナル内部に据え付けられており、 ターミナルと外部(接地)を結ぶセラミック加速管 でイオンを加速し取り出す。ヘリウム、窒素、酸素、 ネオン、アルゴンなどのイオンの取り出しに成功し ている^[6]。KEK-DA のビームコミッショニングでは 先ず 1 価のヘリウムイオンの加速が予定されている。 図 3 は ECR イオン源からの He¹⁺イオン電流値を、 マイクロ波パワーとガス流量をパラメータとして ファラデーカップで測定した結果である。



図3: ECR イオン源から取り出されたイオン電流

4. Einzel レンズチョッパー

ECR イオン源から取り出されるイオンビームは 5 msec の幅を持つ。これは生成されるプラズマの飽和状態に至るまで msec オーダーの時間を要するため、5 msec のパルス状のマイクロ波を導入していることによる。一方、200 kV で加速され KEK-DAリングに後述する静電キッカーで入射される。ビームの周回周期は約 12 µsec であるので、キッカー電圧は入射後この周回時間の前にオフされる必要がある。従って、入射するビーム幅は 5µsec が選ばれた。このために必要なビームチョッパーとして、新方式の Einzel レンズチョッパー (EL チョッパー)を開発し実装した^[7]。EL チョッパー方式の利点として、

安価でコンパクトなこと、ビームが 186 kV の postacceleration を受ける前にチョップするので 2 次電子 放出や X 線の発生が抑制される事、outgas が少な く済むことが特長として挙げられる。

図 4 に EL チョッパーの概念図を示す。アイン ツェルレンズの中間電極の電位をコントロールする ことで下流へのビーム伝搬を制御できる。ゲートと して機能する 17 kV を中間電極に常時印加しておく。 ビームの必要なタイミングに 5µsec 長の-6 kV の矩 形パルス電圧を発生し、17 kV に重畳する事によっ てゲートをオープンしイオンビームの下流への伝搬 を可能とする。即ち縦方向チョッパーとして機能す る。このパルス電圧ソースとしてパワー半導体を用 いた Marx Generator を開発し使用した。



図 4:新開発の EL チョッパー。 Einzel レンズ中間 電極の電位を変えてビームを on/off する。

IGUN^[8]を用いたシミュレーションは中間電極を +17 kV に維持するとビームを阻止でき、+11 kV に 下げると通常の Einzel レンズとしてビームを収束し つつ通過させることができる事を予想した^[7]。図 5 にチョップされたイオンビーム波形を示す。



図 5: イオン源から取り出され post-acceleration を 経、分析磁石でイオン選別を受けたあと、ファラ デーカップで観測された 5msec 幅のイオンビーム (上)と EL チョッパーで切り出された 5 μ sec 幅の ビーム波形(下)。

5. 静電入射キッカー

主リングへのイオンビーム入射のために静電キッ カーを開発した^[9]。入射時の He¹⁺の周回周期は約 12.2 μs である。キッカー電圧が入射終了後のビー ム周回軌道に影響を与えないようにするには入射パ ルス尾部が入射した後、パルス頭部が1周する前に オフにならなければならない。この要求のため、 DC 電源から約 100 m 長の 50 Ω伝送ケーブルを通 してキッカーに 20 kV の電圧を印加しておき、入射 終了後サイラトロンを励起して伝送ケーブルの電荷 を 50 Ωマッチング抵抗に吸収させる。実際の観測 波形を図 6 に示した。



図 6:KEK-DA リングへのイオン入射用静電キッ カーの電圧波形。複数の波形は電場整形用の中間電 極の分圧波形である。

6. KEK-DA リングへのビーム入射

KEK-DA リングに入射された He¹⁺ビームをリン グ内部に設置された静電型バンチモニターで観測し た波形を図7に示す。図7上はリング内に蛍光板を 設置し、ビームを光学カメラで確認しつつ入射した 際のものである。原理的にビームは一周目しか観測 されないが、上流の EL チョッパーのゲート信号か らの Time of Flight が約 12µsec であること、 チョップされた 5µsec 幅のビームが矩形波の形状を 保ったまま入射されていることがはっきりと見て取 れる。図7下は蛍光板を外し、リングの磁場を一定 (0.038 T) にしたままビームを周回させたもので、

約 12.173 µsec 周期でビームが周回し続けていることが確認された。



図 7: KEK-DA に入射された He^{l+}ビームを静電型バ ンチモニターで観測した波形(上図中央)。上図の 左側にあるパルス波形は Einzel レンズチョッパーの ゲート信号である。下は周回するビームを DC 磁場 でリング軌道に閉じ込めたまま観測したもの。

7. バリアー電圧によるビーム閉じ込め

次に誘導加速装置を用いてバリアー電圧を発生させ、ビームを閉じ込めの実験を行った。ビームを加 速しない状態であるため、バリアー電圧の発生タイ ミングは前項で測定された 12.173 µsec 周期に固定 している。図8は入射から10 msec 後のバンチモニ ター信号をバリアー電圧 on/off 時で比較したもの である。バリアー電圧 off 時にははっきり分からな い信号が on 時にはバンチ構造を保っていることが わかる。



図8:入射から10 µsec 後のバンチモニター波形。上 がバリアー電圧 off、下が電圧 on。



図 9: バンチモニター波形の面積から推定したビー ムインテンシティを入射からの時間(msec)に沿っ てプロットしたもの。

図9はlife time を表している。入射直後の急峻な ビームロスは、入射エラーや COD 補正が十分に行 われていないがの原因だあろうと推測している。そ の後の時定数は10⁻⁸ Torr オーダーの真空度における、 He^{l+}イオンの電子捕獲、脱離による寿命では説明で きないので、残留ガスイオンとの衝突によるエミッ タンス増大によって決まると考えている。

8. バリアーバケット圧縮実験

バリアー電圧を用いて、ビームバンチを自由にコ ントロールできることがデジタル加速器の大きな特 長の一つである。実際にバリアー電圧の発生タイミ ングを制御し、バンチを圧縮する実験を行った。実 験の概要は図 10 のようなものである。デジタル加 速器のバリアー電圧制御は DSP (Digital Signal Processor) で行われているが、我々の用いている Texas Instruments 社製の DSP はタイミングパルスを 8 nsec 刻みでコントロールできる。ビームの周回ご とに 1 カウント (8 nsec) ずつバリアー電圧の間隔 を狭くすることでバンチを圧縮しようという実験で ある。



図 10: バンチ圧縮実験の概要。

実験結果を Mountain View にして図 11 に示した。 入射時 5µsec 幅だったビームが圧縮されていくさま が見て取れる。ビームパルス頭部(Mountain View の横軸で 1µsec 付近)でバリアー電圧により反射さ れた入射時バンチ頭部だった部分がバンチ尾部と交 差する様子も鮮明に映し出されている。「バリアー 電圧パルス生成のタイミングから決まる運動量から 一定のオフセットを持ってイオンバンチが入射され、 バリアー電圧で反射されることでこのように見えて いるであろう」とスペキュレーションが容易に浮か ぶ。縦方向の運動をシミュレートするプログラムを 用いてこの推論を検証した結果を図 12 に示す。シ ミュレーションでは momentum spread 0.13 %, momentum off-set 0.13 %を仮定している。



図 11:バリアー電圧を用いてバンチを圧縮した際 の Mountain View の射影。縦軸が入射後の時間の 進み、横軸が周回時間。周回時間内の粒子分布 (色分けして示す)赤い分布の左端がビームパル ス頭部、右端が尾部に当たる。頭部と尾部がほぼ 直線上に移動し、入射後 1.5 msec で交差してい る。時間的に上流へ移動して来る正のバリアー電 圧パルス部まで移動した頭部(入射時)はバリ アーパルスに反射され向きを変えるのが見て取れ る。バリアーバケット圧縮実験の間、ビームパル スは完全にバリアー内に閉じ込められているのが 分かる。





図 12: バリアーバケットを一方向に圧縮しながら ビームを閉じ込める実験をシミュレーションしたも の。入射するビームバンチは理想運動量に対して $\Delta p/p = 0.13\%$ のオフセットを持つと仮定した。

9. まとめ

KEK-DA 計画は加速器の建設を完了し、コミッ ショニングの段階に移行した。第一段階として 200 kV 高圧ターミナルからの He¹⁺イオンビームの取り 出し、第二段階として KEK-DA リングまでのビー ム輸送、第三段階としてリングへのビーム入射、第 四段階としてリング周回およびビーム閉じ込め実験 に成功した。今後は引き続きビーム加速、取り出し 実験をテストとして行い、放射線施設検査後ビーム 応用ラインにビームを供給する予定である。

参考文献

- K.Takayama, Y.Arakida, T.Iwashita, Y.Shimosaki, T.Dixit, K.Torikai, J. of Appl. Phys. 101, p063304-7 (2007). Patent No. 3896420, PCT/JP2006/308502 (2006)
- [2] K.Takayama and J.Kishiro, Nucl. Inst. Meth. A 451, 304 (2000).
- [3] K.Takayama, Y.Arakida, T,Dixit, T.Iwashita, T.Kono, E.Nakamura, K.Otsuka, Y.Shimosaki, K.Torikai, and M.Wake, *Phys. Rev. Lett.*, **98**, p054801-4 (2007), K.Takayama, Chapters 11 and 12 in "Induction Accelerators", K.Takayama and R.Briggs (*Eds.*) (Springer, 2010).
- [4] T.Dixit, T.Iwashita, and K.Takayama, Nucl. Inst. Meth. A 602 326 (2009).
- [5] T.Iwashita, T. Adachi, K.Takayama et al., Phys. Rev. ST Accel. Beams 14, 071301 (2011)
- [6] K.W.Leo, T. Adachi, T. Arai, K. Okazaki, and K.Takayama, in *Proceedings in ICIS2011* (2011).
- [7] T. Adachi, T. Arai, K. W. Leo, K. Takayama, and A. Tokuchi, *Rev. Sci. Inst.* (2011) in print.
- [8] R. Becker and W. B. Herrmannsfeldt, "Igun A program for the simulation of positive ion extraction including magnetic fields". *Rev. Sci. Inst.*, 63, 2756 (1992).
- [9] T.Adachi, T.Kawakubo and T.Yoshii, "Injection and Extraction System for the KEK Digital Accelerator" in *Proceedings of IPAC'10*, MOPEC050, 570 (2010).